

大気基準適用施設

(ng: ナノグラム=10億分の1グラム)

排出基準[平成14年12月1日～] (単位:ng-TEQ/m³N)

特定施設の種類		新設炉	既設炉
1 焼結鉱製造用焼結炉(銑鉄製造用) 処理能力 1t/h 以上		0.1	1 (※1)
2 製鋼用電気炉(鑄鋼・鍛鋼製造用を除く) 定格容量 1,000kVA 以上		0.5	5 (※2)
3 亜鉛回収用焙焼炉・焼結炉・溶鉱炉・溶解炉・乾燥炉 処理能力 0.5t/h 以上		1	10 (※1)
4 アルミニウム合金製造用焙焼炉・乾燥炉(処理能力 0.5 t/h 以上)及び溶解炉(容量 1t 以上)		1	5 (※1)
5 廃棄物焼却炉(火床面積 0.5 m ² 以上又は焼却能力 50kg/h 以上)	燃焼能力 4t/h 以上	0.1	1 (※3)
	燃焼能力 2t/h～4t/h 未満	1	5 (※3)
	燃焼能力 2t/h 未満	5	10 (※3)

(ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1, 同施行規則別表第1, 同施行規則附則別表第1, 第2)

※1 平成12年1月15日までに設置されている施設については、既設の基準を準用(着工している施設を含む)

※2 平成9年12月2日以降に着工した施設については、新設の基準を適用

※3 平成9年12月2日以降に着工した廃棄物焼却炉(火格子面積が²2 m²以上または焼却能力が³200 kg/h 以上のもの)については、新設の基準を適用

水質基準対象施設[平成 15 年 1 月 15 日～] (単位 pg-TEQ/L)

特定施設の種類	規制基準 (pg-TEQ/L)
1 硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)製造用 塩素又は塩化合物による漂白施設	10
2 カーバイト法アセチレン製造用 アセチレン洗浄施設	10
3 硫酸カリウム製造用 廃ガス洗浄施設	10
4 アルミナ繊維製造用 廃ガス洗浄施設	10
5 担体付き触媒の製造用(塩素又は塩素化合物を使用するものに限る)焼成炉から 発生するガスを処理する廃ガス洗浄施設	10
6 塩化ビニルモノマー製造用 二塩化エチレン洗浄施設	10
7 カプロラクタムの製造用(塩化ニトロシルを使用するものに限る) ・イ 硫酸濃縮施設 ・ロ シクロヘキサン分離施設 ・ハ 廃ガス洗浄施設	10
8 クロロベンゼン又はジクロロベンゼン製造用 ・イ 水洗施設 ・ロ 廃ガス洗浄施設	10
9 四-クロロフタル酸水素ナトリウム製造用 ・イ ろ過施設 ・ロ 乾燥施設 ・ハ 廃ガス洗浄施設	10
10 ニ・三-ジクロロ-一・四-ナフトキノンの製造用 ・イ ろ過施設 ・ロ 廃ガス洗浄施設	10
11 ジオキサジンバイオレット製造用 ・イ ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設 ・ロ ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設 ・ハ ジオキサジンバイオレット洗浄施設 ・ニ 熱風乾燥施設	10
12 アルミニウム又はその合金製造用焙焼炉・溶解炉・乾燥炉から発生するガスの処 理施設 ・イ 廃ガス洗浄施設 ・ロ 湿式集じん施設	10
13 亜鉛の回収施設(製鋼用電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集 められたものからの亜鉛の回収に限る)	10

<ul style="list-style-type: none"> ・イ 精製施設 ・ロ 廃ガス洗浄施設 ・ハ 湿式集じん施設 	
<p>14 担体付き触媒(使用済みのものに限る)からの金属の回収(ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法(焙焼炉で処理しないものに限る)によるものを除く)用</p> <ul style="list-style-type: none"> ・イ ろ過施設 ・ロ 精製施設 ・ハ 廃ガス洗浄施設 	10
<p>15 ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設のうち次に掲げるもの及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ・イ 廃ガス洗浄施設 ・ロ 湿式集じん施設 	10
<p>16 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第12号の2及び第13号に掲げる施設</p>	10
<p>17 フロン類(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令別表1の項、3の項及び6の項に掲げる特定物質をいう)の破壊(プラズマを用いて破壊する方法その他の環境省令で定める方法によるものに限る)用</p> <ul style="list-style-type: none"> ・イ プラズマ反応施設 ・ロ 廃ガス洗浄施設 ・ハ 湿式集じん施設 	10
<p>18 下水道終末処理施設(第1号から前号まで及び次号に掲げる施設に係る汚水又は廃液を含む下水を処理するものに限る)</p>	10
<p>19 第1号から第17号までに掲げる施設を設置する工場又は事業場から排出される水(第1号から第17号までに掲げる施設に係る汚水若しくは廃液又は当該汚水若しくは廃液を処理したものを含むものに限り、公共用水域に排出されるものを除く)の処理施設(前号に掲げるものを除く)</p>	10

(ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第2, 同施行規則別表第2, 同施行規則附則別表第3)

廃棄物焼却炉に係るばいじん等の濃度基準

[平成14年12月1日～]

ばいじん、焼却灰その他燃え殻中の含有量 3ng-TEQ 以下

ただし、平成12年1月15日以前に設置された施設について、下記の処理をした場合は基準が適用されません。

ア セメント固化

イ 薬剤処理(重金属の安定化)

ウ 酸及び溶媒による重金属溶出除去